

JST未来社会創造事業

「レーザー駆動による量子ビーム加速器の開発と実証」 - 電子加速システムの開発 -2022年度第2回シンポジウム

日 時 : 2023年2月28日(火)13時30分~16時10分(13時00分開場)

主催:「レーザー駆動による量子ビーム加速器の開発と実証」プロジェクト

高エネルギーX線を用いたコンプトン散乱による HIP接合界面検査と社会インフラ設備への適用可能性

群馬大学理工学府電子情報部門 櫻井 浩





JST未来社会創造事業

「レーザー駆動による量子ビーム加速器の開発と実証」 – 電子加速システムの開発 – 2022年度第2回シンポジウム

日 時 : 2023年2月28日(火)13時30分~16時10分(13時00分開場)

主催:「レーザー駆動による量子ビーム加速器の開発と実証」プロジェクト

高エネルギーX線を用いたコンプトン散乱による HIP接合界面検査と社会インフラ設備への適用可能性

群馬大学理工学府電子情報部門 櫻井 浩



コンプトン散乱イメージングによる接合界面の健全性評価





Kishimoto et al. Fusion Eng. Des. 109-111, 1744-1747 (2016)

H. Kishimoto et al., J. Nucl. Mater. 442 (2013) S546-S551.





第一壁部材製作時には品質保証が必要。

HIP 接合界面の配置が三次元的であるため、全接合部において<u>接合欠陥の有無を精査</u>することは困難 接合継手特性に影響を与える<u>酸化物のサイズは、数µm 程度</u>であるため、検出は極めて難しい

HIP接合界面の検査方法は破壊・非破壊的手法とも確立されていない HIP界面近傍の組織の学術的理解と評価技術の開発が必要

廣瀬貴規, 芹澤久, 岸本弘立, 荻原寛之, 藤井英俊, 長坂琢也, 笠田竜太, 野澤貴史, 谷川博康, 芝清之, 低放射化フェライト鋼接合技術の現状と課題, J. Plasma Fusion Res. 87, 172-180 (2011)



拡散接合部の非破壊評価試験法

X 線透過試験, 超音波探傷試験, 浸透探傷試験, 電気抵抗測定, AE 測定等

拡散接合部に残留する微小な欠陥を検出できる可能 性の高いのは<u>超音波探傷,X線透過試験</u>

空間分解能が足りない

超音波探傷(数百μm) • X線透過試験(20μm)

大橋修,入門講座・拡散接合その4—接合部の金属学的・機械的評価,気密性,接合部の非破壊評価—,まてりあ 57,620-624 (2018).

HIP界面の非破壊検査法



Destructive and non-destructive evaluation methods of interface on F82H HIPed joints

Hirotatsu Kishimoto^{a,b,*}, Yusuke Muramatsu^b, Yuki Asakura^{a,b}, Tetsuo Endo^b, Akira Kohyama^a

^a OASIS, Muroran Institute of Technology, 27-1, Muroran, Hokkaido, Japan^b Graduate School, Muroran Institute of Technology, 27-1, Muroran, Hokkaido, Japan

Fusion Engineering and Design 109-111 (2016) 1744-1747



Fig. 3. Schematic image of fabrication and the dimension of cross section of first wall.





125MHzでecho強度減少

Characterization of torsion fracture behavior of F82H HIP joints with damage monitoring by acoustic emission

Takashi Nozawa*, Ryuji Ohsone, Hiroyasu Tanigawa

National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology, 2-166 Omotedate, Obuchi, Rokkasho, Aomori 039-3212, Japan

Fusion Engineering and Design 124 (2017) 985-989



Fig. 2. Photo images of torsion test setup with two acoustic emission se



Fig. 4. Typical wave signal by AE monitoring.



Acoustic emissionをモニ ターすればUpper shelf energyがわかる

非破壊で化学的情報を計測できないか? <u>1µmの界面</u>

コンプトン散乱X線エネルギースペクトル解析でHIP界面 の酸化物を評価する

コンプトン散乱X線スペクトル形状は波動関数=化学結合を反映



評価



コンプトン散乱X線のエネルギースペクトルの形の解析 (Sパラメータ解析法)



コンプトンプロファイルのラインシェイプを数値化するパラメータを考案 (Sパラメータ解析法) K. Suzuki et al.



Sパラメータからリチウム量の定量が可能



Sパラメタ解析によるリチウム電池のリチウムイオン分布測定



K. Suzuki et al. Condens. Matter 3, 27 (2018)

充電速度が速い(1C>0.2C)時はLiが負極/セパレータ界面に集積

接合界面の非破壊検査手法とならないか



測定試料~HIP接合したF82H鋼

核融合研究開発

9 - 3実構造体 HIP 接合部の破壊挙動を追う

ー核融合原型炉開発で進められている低放射化フェライト鋼研究の最前線ー

112 原子力機構の研究開発成果 2014

F82H-BA12



specification values.									
Element	С	Cr	w	Mn	v	Та	Si		
F82H (spec.)	0.08-0.12	7,5-8,5	1.6-2.2	0.05-0.5	0.15-0.25	0.02-0.10	<0.2		
F82H-pre. IEA	0.097	7.46	2.10	0.07	0.18	0.030	0.09		
F82H-IEA	0.09	7.64-7.87	1.94-1.98	0.10-0.16	0.16-0.19	0.02-0.04	0.07-0.11		
F82H-BLK	0.095	7.72-7.74	1.95	0.10	0.18	0.04	0.10		
F82H-BA07	0.088-	7.97-8.02	1.88	0.45-0.46	0.19	0.03-0.04	0.16-0.17		
	0.091								
F82H-BA10	0.094	7.83	1.89	0.48	0.20	0.027	0.11		
F82H-BA11	0.10-	7.91-	1.81-	0.46-0.47	0.20	0.037-	0.11-0.15		
STG	0.104	7.99	1.91			0.05			
F82H-BA12	0.099	7.88 🤇	1.78	0.45	0.19	0.093	0.10		

Table 3-A1-1: Chemical compositions (wt.%) analyzed. Note that chemical compositions of "F82H" are





W, Ta, SiO2に着目





X-ray

HIP interface

9

SPring-8 BL08Wにおけるコンプトン散乱X線エネルギー スペクトルの測定







測定した散乱X線エネルギースペクトル





Ta、Wの定量

OTa、Wの蛍光X線強度に比例

SiO2の体積比

○コンプトン散乱X線の積分強度⇒電子密度を反映 ○レーリー散乱/コンプトン散乱の強度比が物質に依存 〇コンプトン散乱X線ピークの幅が物質依存(sparameter解析)



X線強度(コンプトン散乱X線、レーリー散乱 群馬 国立大学法人 University Corporation GUNM 線、蛍光X線(Wka, WKb))とS-parameterのz依存 性 F82H-BA12 [×10⁵]² Compton scattering X-rays WKα 10 counts/20min. <u>10</u> X-ray incident NC5-c01 WKβ X-rays 115.7keV NC5-c02 Τα Κα 0∟ 40 試料面最上端がz=0 80 100 60 120 10 energy(keV) 1.5 1.5 10 X-ray HIP interface У F82H-BA with HIPed joint Х Ζ

各X線強度のz依存性を測定



X線強度(コンプトン散乱X線、レーリー散乱 線、蛍光X線(Wka, WKb))とS-parameterのz依存



Ta・W蛍光強度、コンプトン散乱・レー リー散乱強度、Sパラメターの相関

Table 1

Correlation coefficients between deviations shown in Fig. 4(b).

	WKα	ΤаΚα	Compton scattering	Elastic scattering	S- parameter
WKα TaKα Compton	1.00	0.25 1.00 (0.39 0.63 1.00	0.54 0.38 0.71	0.16 0.02 0.44
Elastic scattering				1.00	0.33
S-parameter					1.00

Ta、Wの定量化

○Ta、Wの蛍光X線強度に単純比例

SiO2の体積比定量化~3つの手法を比較

コンプトン散乱X線の積分強度⇒電子密度を反映
レーリー散乱/コンプトン散乱の強度比が物質に依存
コンプトン散乱X線ピークの幅が物質依存(<u>s-</u>parameter解析)



SiO2体積比の見積り手法~その1

○コンプトン散乱X線の積分強度⇒電子密度に比例

$$\mathrm{d}N = \Phi_0 t_1 t_2 \rho_e \,\mathrm{d}V \,\frac{\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{KN}}}{\mathrm{d}\Omega}$$

Relative Compton scattering X-ray Intensity



母合金からの強度のずれからSiO2体積比が見積もれる



SiO2体積比の見積り手法~その2

〇レーリー散乱/コンプトン散乱の強度比が物質に依存





コンプトンプロファイルのラインシェイプを数値化するパラメータを考案 (Sパラメータ解析法)





散乱・蛍光X線強度の母合金の平均からの偏差を解析



蛍光X線強度→元素の量に比例

OTaはHIP接合界面に0.01wt%集積。界面近傍では 0.005wt%減少

OWはHIP接合界面近傍に0.01wt% 集積。母合金内いた るところで0.01wt% ぐらい組成揺らぎ。

コンプトン散乱X線は電子密度に比例

OSiO2はHIP接合界面で0.5-1vol%(20µm tに対して) ⇒HIP界面でのSiO2の平均厚0.1-0.2µm OHIP界面近傍ではSiが減少 OSiO2の挙動はTaの挙動と対応

非破壊で化学的情報を計測 OHIP界面のSiOxコア、TaOxシェル構造を反映

T. Nozawa et al., J. Nucl. Mater. 427 (2012) 282-289.

H. Kishimoto et al., J. Nucl. Mater. 442 (2013) S546-S551.

R. Ohsone et at., in: 12th International Symposium on Fusion Nuclear Technology, Jeju Island, Korea, 2015

OHIP界面近傍のSiとTaが拡散して酸素と反応。 OHIP界面近傍にWが拡散(SiとTaの欠乏部分?)



実験から得られた結論



原理的には高エネルギーX線散乱スペク トル解析・イメージングによる接合界面 の健全性評価は可能

非破壊で化学的情報を計測 OHIP界面のSiOxコア、TaOxシェル構造を反映

T. Nozawa et al., J. Nucl. Mater. 427 (2012) 282-289.

H. Kishimoto et al., J. Nucl. Mater. 442 (2013) S546-S551.

R. Ohsone et at., in: 12th International Symposium on Fusion Nuclear Technology, Jeju Island, Korea, 2015

OHIP界面近傍のSiとTaが拡散して酸素と反応。 OHIP界面近傍にWが拡散(SiとTaの欠乏部分?)

Development of non-destructive testing (NDT) technique for HIPed interface by Compton scattering X-ray spectroscopy

Hiroshi Sakurai ^{a,*}, Kosuke Suzuki ^a, Shoya Ishii ^a, Kazushi Hoshi ^a, Takashi Nozawa ^b, Hidetsugu Ozaki ^c, Hiroto Haga ^c, Hiroyasu Tanigawa ^b, Yoji Someya ^b, Masao Tsuchiya ^c, Hiroshi Takeuchi ^c, Naruki Tsuji ^d

^a Graduate School of Science and Technology, Gunma University, 1-5-1 Tenjin-cho, Kiryu, Gunma, 376-8515, Japan

^b National Institutes for Quantum Science and Technology, 2-166 Omotedate, Obuchi, Rokkasho, Aomori 039-3212, Japan

^c Metal Technology Co. Ltd., 1-32-2 Honcho, Nakano-Ku, Tokyo 164-8721, Japan

^d Japan Synchrotron Radiation Research Institute, 1-1-1, Kouto, Sayo-cho, Sayo-gun, Hyogo 679-5198, Japan

Nuclear Materials and Energy 31 (2022) 101171



PHITSによるシミュレーションによる検証





コンプトン用HPGe 半径3cm厚さ5cm **鉛スリット** 縦5cm横5cm奥行10cm **鉛スリット間** 0.1cm **陽電子用HPGe** 半径3cm厚さ5cm **F82H(ターゲット)** 縦0.15cm横1cm奥行1cm **F82Hの間のガラス** 縦0.001cm横1cm奥行1cm **ターゲット横の鉄の円柱** 半径0.5cm厚さ6cm

PHITSシミュレーションによる検証の結論





高エネルギーX線散乱スペクトル 実験を概ね再現 HIP界面でのSパラメーター増加、 コンプトン散乱X線強度減少を再現

PHITSシミュレーションによるF82H鋼HIP界面の非破壊検査法の検討が 可能



JST未来社会創造事業

「レーザー駆動による量子ビーム加速器の開発と実証」 – 電子加速システムの開発 – 2022年度第2回シンポジウム

日 時 : 2023年2月28日(火)13時30分~16時10分(13時00分開場)

主催:「レーザー駆動による量子ビーム加速器の開発と実証」プロジェクト

高エネルギーX線を用いたコンプトン散乱による HIP接合界面検査と社会インフラ設備への適用可能性

群馬大学理工学府電子情報部門 櫻井 浩





高エネルギーX線を用いたコンプトン散乱による社会インフラ設備への適用可能性

核融合原型炉におけるブランケットモデュールのHIP 接合界面の非破壊評価手法



大型構造物の非破壊検査装置

ロボットアーム搭載









(コンクリート構造物)





X線のprobing depth



通常のX線源の利用を考え る場合



医療用LINACなど特殊な 光源を考える場合



エネルギーが高いほうが有利 (SPring-8では182keVまで実績あり) 1cm程度が限界。3cm以上は難しい

10MeVぐらいが透過率最大 検出器が問題?1MeV程度なら可能





準単色光源の性能





0.1%⇒10^6 photons/min が必要



磁気コンプトン散乱

磁気コンプトン散乱による、ネオジム磁石内部の保磁力分布 ▶ バルク(製品のまま)状態のネオジム商用磁石において

表面から内部までの保磁力分布を非破壊で観測することに成功





コンプトン散乱強度・Sparameter解析



H. Kishimoto et al., J. Nucl. Mater. 442 (2013) S546-S551.

円偏光反転による深部磁気探傷 μmスケールの欠陥



深部の磁化が非破壊 で測定できる 高エネルギー円偏光X線散乱イメージングのイメージ図







高エネルギーX線を用いたコンプトン散乱による社会インフラ設備への適用可能性

核融合原型炉におけるブランケットモデュールのHIP 接合界面の非破壊評価手法



大型構造物の非破壊検査装置

ロボットアーム搭載



ご清聴ありがとうございました

